# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-162215

(43) Date of publication of application: 05.06.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/84 G01R 33/032

G11B 5/82

(21)Application number: 02-288033

(71)Applicant: HITACHI ELECTRON ENG CO

LTD

(22)Date of filing:

25.10.1990

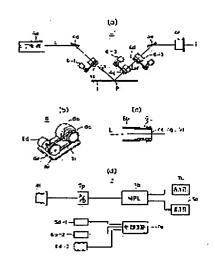
(72)Inventor: MORI KAZUYUKI

**HONMA KAZUO** 

# (54) ADJUSTING MECHANISM OF COERCIVE-FORCE MEASURING OPTICAL SYSTEM (57) Abstract:

PURPOSE: To conduct the angular adjustment of an optical system and the measurement of coercive force to a plurality of each measuring point of a large number of magnetic disks quickly and accurately by automating the angular adjustment of a polarizer, a  $\lambda/4$  plate and an analyzer by controlling a micro- processor.

CONSTITUTION: A polarizer 4c, through which linearly polarized beams output from a laser beam source 4a are transmitted, a  $\lambda/4$  plate 4g converting elliptically polarized reflected beams by a protective film into linearly polarized beams, and an analyzer 4d, through which linearly polarized beams output from the  $\lambda/14$  plate 4g are transmitted, are mounted to a rotatable lensbarrel 6a respectively. The lens-barrel 6a is turned by a



stepping motor 6d controlled by a micro-processor 7b while referring to the detecting currents of a photo-detector 4f, and adjusted automatically at an optimum angle. Accordingly, the angle of an optical system to a plurality of each measuring point of a large number of magnetic disks 1 is adjusted easily, and the effects of protective films having different optical characteristics are removed, thus precisely measuring the coercive force of a magnetic medium.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ® 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-162215

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月5日

G 11 B 5/84 G 01 R 33/032 G 11 B 5/82

C 7177-5D 8203-2G 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**9発明の名称** 保磁力測定光学系の調整機構

②特 願 平2-288033

❷出 願 平2(1990)10月25日

@発 明 者 森

和行

男

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

@発明者 本間 一

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

勿出 願 人 日立電子エンジニアリ

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

ング株式会社

四代 理 人 弁理士 梶山 佶是

外1名

### 明和音

- 1.発明の名称 保磁力測定光学系の調整機構
- 2.特許請求の範囲
- (1) 磁気ディスクの磁気媒体の測定点を磁化する 磁化装置を具備し、直線偏光ピームを出力するレ ーザ光原、該直線偏光ピームを透過して投射ピー ムとして前記測定点に投射する偏光子、前記測定 点により反射され、前起磁気媒体のカー効果によ り傷光面が回転し、かつ前配磁気媒体に塗布され た保護膜により楕円偏光化された反射ビームを直 線偏光化する入/4板、および終入/4板の出力 する直線偏光ビームに対する検光子と受光器より なる光学系を有する保磁力測定装置において、前 記傷光子、前記入/4板、および前記検光子をそ れぞれ装着する回転可能な機体と、各該機能をス テップ回転するステップモータ、および前記受光 器の出力する検出電流を参照して、各族ステップ モータの回転を制御し、前配偏光子、前記入/4 仮、および前配検光子のそれぞれの回転角度を最 適に関密するマイクロプロセッサとにより構成さ

れたことを特徴とする、保磁力測定光学系の製整機構。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、磁気ディスクの保磁力測定装置の 光学系の興整機構に関するものである。

[従来の技術]

最近においては、磁気ディスクの記録密度はますます向上し、これに対して磁気媒体の数細な磁区の保磁力を正確に測定することが重要となっている。

第2図(a),(b),(c) により磁気ディスク保磁力制定装置の概要を説明する。図(a) において、鉄心2a, 提線2b-1, 2b-2 よりなる電磁石2を配石2を設置が構成され、推線に交替器をは、 在交替器を供給して鉄心のギャップ G に発音を発音して鉄心の底面に適当な関係をおける。電磁石2の底面に適当な関係をおけるの磁気ディスク1を装し、ギャッグの磁力を使力を設定点 P が磁化され、この磁化度が が と が で と が 別定される。光学系 4 において、レーザ

光顔 4a よりのレーザビームしは、ミラー 4b に より光輪が斜め45。下向きとされて偏光子4c に入力し、直線偏光の投射ビームLT が測定点p に対して役射される。投射ビームLI は測定点P で正反射して反射ビームLBとなるが、その偏光 面は磁気的カー効果により測定点pの磁化度に比 例して、図(b) に示すように角度280を変化す る。ただし、投射ビームLT と反射ビームLR の 個光面には角度ズレ、すなわちなすオフセット角 θがあるので、反射ビームLR の偏光面の角度は  $(\theta \pm \delta \, \theta)$  である。これに対して検光子  $4 \, d \, \sigma$ **個光面を角度θの方向にオフセットし、検光子4** d を透過した反射ピーム LR はミラー 4e を経て 受光器41 に受光され、その検出電流 j の大きさ により偏光面の回転角度δθ、従って測定点Pの 磁化度が測定される。図(c) は保健力の求め方を 説明するもので、励磁電流』を制御して磁界Hを 正負の方向に往復して段階的に変化し、各段階で とに上記の磁化度測定を行って、磁界日に対する 磁化度K(または検出電流i)のヒステリシス®

ループ曲線がえられる。この曲線と水平軸(H軸) の交点が測定点りの保磁力士Hc を表し、士Hc は磁界Hと磁化度Kのデータを用いてマイクロブ ロセッサにより計算される。

以上の保護質が塗布された磁気ディスクにおいては、保護膜により投射ビームの偏光面に変化を 生ずる。従って磁気媒体による編光面の回転に対

して、さらにこの変化が加わって保磁力の測定に 誤差を生ずるので、その対策が必要である。

第3図(a) において一般的な透明誘電体5をと り、その表面を5a 裏面を5b とし、表面側より 直級偏光ビームLT を入射角ので投射するものと する。投射ピームLT は表面5a により外部反射 されるとともに、裏面5bにより内部反射される が、偏光面の変化はこの内部反射により生ずるも ので、直線偏光の役射ビームLIは楕円偏光の反 射ビームLB′に変化する。このように直線偏光 が楕円化される程度は、誘電体5の屈折率 n と入 射角φに依存して変わり、例えば n が~ 1. 50 の場合は中が50°付近で最も強く楕円化され、 **φが0。または80。に近いほど楕円化が少ない** ことが知られている。 (Jenkins/White , 光学の 基礎、IV版、 p p 531-533, 『内部反射による楕円 偏光光」参照)。第2図(a) に示した光学系4の 入射角はほぼ45°であり、また保護膜は透明な 誘電体であるから、反射ビーム LR ′ が楕円偏光 であることは明らかである。これに対して検光子

第3図(c) は以上の考察により構成された、反射ビームLR 'を直線偏光に変換して保留力を測定する光学系4'を示すもので、前記の第2図(a) の光学系4の測定点pと検光子4d の間に、2/4収4g を追加したものである。

#### [解決しようとする課題]

以上に述べたように、反射ピームLR′の偏光 面は磁気媒体により角度( $\theta$   $\pm$   $\delta$   $\theta$ )回転し、さ らに保護膜により楕円化するので、これを入/4 板 4g により直線化して角度 ( $\theta$ '  $\pm \delta$   $\theta$ ) の偏 光面の反射ビーム LR \* をうるのであるが、保磁 力を正確に測定するためには保護膜の種類ごとに 入/4板4g と検光子4d の角度調整を行うこと で十分な筈である。しかし、実際上では1枚の磁 気ディスクに対して複数の測定点の測定を行う場 合に、同一の保護膜であるにも拘らず、入/4板 4gと検光子4dの再調整を必要することが経験 されている。しかしながら、手作業による上記の 調整作業では必ずしも正確な調整が期待できず、 また多数の磁気ディスクに対して測定点ごとに、 このような再調整を行うことは非能率で測定装置 の稼働率が低下する。なお、レーザ光源を交換し た場合などには、偏光子4cの角度調整も必要で あり、これを含めて各要素の角度を効率的に顕整 できる機構が望まれている。

れの回転角度を最適に調整するマイクロプロセッサとにより構成される。

#### [作用]

以上の構にという。 という。 という。 はは、という。 はは、いう。 はないった。 はないった。 はないった。 はないった。 はないった。 はないった。 はないった。 はないる。 はないった。 はないる。 はなる。 はない。 はない。 はないる。 はないる。 はないる。 はない。 はないる。 はないる。 はないる。 はない。 はない。 はないる。 はないる。 はないる。 はない。 

#### [実施例]

第1図(a) ~(d) は、この発明による保磁力制 定光学系の調整機構の実施例を示す。図(a) にお いて、4' はこの発明による調整機構を具備した この発明は、以上に鑑みてなされたもので、偏 光子、 入/4板および検光子の角度調整をマイク ロプロセッサの制御により自動化した調整機構を 提供することを目的とするものである。

#### [課題を解決するための手段]

光学系を示し、レーザ光源48 より出力される直 線偏光のレーザピームしは、ミラー4b により反 射されてほぼ45°の斜め下向きに進み、回転機 構 8-1に接着された偏光子 4c を透過し、投射ビ ームLTとして測定点pに投射される。測定点p における反射ビームLR′は、回転機構8-2に装 着された入/4板4g により直線化され、さらに 回転機構 8-3に装着された検光子 4 d より偏光角 の変化に対応するピームが出力される。このピー ムはミラー4mを軽て受光器4mに受光され、偏 光角の変化を示す検出電流iが出力され、磁気媒 体の磁化度が測定される。ここで、各回転機機も -1, B-2, B-3の構造を図(b),(c) により説明す る。回転機構8は、偏光子4c,入/4板4g,また は検光子4dを装着して回転可能な鏡筒8aと、 鏡筒Ba を支持してベースBc に固定される支持 筒 B b 、および鏡筒 B a を回転するスチップモー タBd,プーリ6e,ベルト61 よりなる。

第3図(d) はMPU7b により各回転機構のステップモータのd-1,8d-2,8d-3 を制御して光学

## 特開平4-162215(4)

系4′の調整を行う調整回路7のブロック系統図 を示す。光学系4′の調整においては、励磁電流 をりとして磁気ディスクの所定の選定点りを磁化 せずにおく。この測定点に投射ビームしTを投射 して反射ビームLRグを受光器4~に受光し、そ の検出電流iをA/D変換器7a によりデジタル 化してMPU7bに取り込んで監視する。入力部 7c より、調整箇所としてまずステップモータ6 d-1 を指定し、MPU7b と制御回路7e により 検出電流iが最大となるように、ステップモータ Rd-1 を回転して個光子4cの角度を調整する。 これにより偏光子4c の偏光角がレーザピームし の偏光角に一致する。次に、ステップモータ8d-2 を指定してほぼ同様な方法により、 入/4板4 gの角度調整を行って楕円偏光を直線偏光に変換 し、最後にステップモータBd-3 を指定して検出 電流」が最大となるように検光子4d を回転する と、検光子4d の偏光面がオフセット角 8° に調 整される。なお、上記の黝整手順は1例であって、 調整箇所の指定順序や、それぞれの調整方法が上

記と多少異なる場合がありうるが、いずれにして も偏光子4c, 入/4板4g および検光子4d の それぞれの角度が、MPU7b により制御されて 最適値に自動的に調整される。以上の調整作業が 終了後、その測定点に対する保磁力測定を行い、 以下の各測定点に対しても上記と同様の調整と測 定が逐次行われる。

#### [発明の効果]

以上の説明により明らかなように、この発明に よる保磁力測定光学系の調整機構においては、レ ーザ光潔よりの直線偏光ピームを透過する偏光子 と、保護膜により楕円偏光とされた反射ビームを 直線偏光に変換する入/4板と、入/4板の出力 する直線偏光ピームを透過する検光子は、いずれ も回転可能な鏡筒に装着され、受光器の検出電流 を参照してマイクロプロセッサに制御されたステ ップモータによりそれぞれ回転され、最適の角度 に趙整されるもので、多数の磁気ディスクのそれ ぞれの複数の測定点に対する光学系の角度調整と 保磁力の測定が、ともに迅速かつ正確に行われ、

磁気ディスク保磁力測定装置の稼働率と測定デー タの信頼性の向上に寄与するところには大きいも のがある。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図(a),(b),(c) および(d) は、この発明に よる保磁力測定光学系の調整機構の実施例におけ る光学系の構成図と、回転機構の構造図、および 周整回路のブロック図、第2図(a),(b) および(c) は、磁気ディスク保磁力測定装置の構成図と磁 気媒体の保磁力の側定方法の説明図、第3図(a), (b) および(c) は、磁気ディスクの保護膜の保磁 力測定に及ぼす影響の説明図と、これを排除する 光学系の構成図である。

1…磁気ディスク、 2…電磁石、

2 b-1,2 b-2 …抱線、 2 a …鉄心、

3…励磁機、 4, 4'…光学系、

4a …レーザ光顔、 4b,4e ... ミラー、

4 c … 偏光子、 4 d … 快光子、

41 …受光器、 48 … 入/4板、

5 ··· 透明誘電体、 5 a ··· 安面、 5 b ··· 宴面、

6…回転機構、

6 a ・・・鏡筒、

Bb …支持简、

βc ···ベース、

8d,8d-1,8d-2,6d-3 …ステップモータ、

Be …ブーリ、

81 …ベルト、

7…凋整回路、

7a ··· A/D 変換器、

7b ... マイクロプロセッサ (MPU)、

7 c … 入力部、

7 4 …出力配、

7e …制御回路。

#### 特許出顧人

日立電子エンジニアリング株式会社

代理人 弁理士 梶 山 佶 是 弁理士 山 本 富上男

# 特開平 4-162215 (5)

